

特許 & 技術レポート

河 合同特許法律事務所 / SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

2026-01

ハイライト：

韓国、2029年から全言語による特許出願が可能に	1
サムスン電子、米国OLED特許訴訟で1億9,000万ドルの賠償命令	2
量子コンピューティング商用技術が急成長、産業適用本格化の兆し	3
「バッテリーの負極をなくしたら」電気自動車の走行距離が2倍に...1回の充電でソウル・釜山を往復	4
「メロナ＝ビングレ」カザフスタンで「ニセモノ撲滅」の商標権訴訟	5
ブランドバッグのリフォームは商標権侵害か...大法院、ルイ・ヴィトン事件で公開弁論	6



IP制度

韓国、2029年から
全言語による特許出願が可能に

特許法条約(PLT)加盟推進によって「グローバル特許セーフティネット」を構築

韓国は、国際特許制度の中核を成す「特許法条約(PLT)」への加盟を推進し、企業のイノベーション成果を知的財産として保護する制度的セーフティネットを大幅に強化する。

知識財産処は、2029年までのPLT加盟を目標としてタスクフォースを発足し、出願手続の簡素化、権利回復制度の拡充、公証要件の緩和など、特許手続全般の改革を本格的に推進すると発表した。

2029年に特許法条約に加盟すれば、従来の韓国語と英語に加え、すべての言語による特許出願が可能となる。また、印鑑証明書なしに、サインのみで特許権の移転が可能となるなど、公証・認証手続も緩和される見通しである。

特に、特許法条約(PLT)への加盟により、国家戦略技術の海外における権利保護を強化し、企業の特許獲得を阻んできた規制の撤廃が可能になると期待されている。

PLTは特許手続を国際基準で統一し、ミスや形式的な不備によって特許権を喪失する事態を最小限に抑えるために制定された国際条約であり、米国、日本、英国

など43ヶ国が加盟している。今回の加盟推進は、2025年11月14日の韓米首脳会談共同説明資料にも明示された国家的課題であり、先端産業の競争が激化する国際環境の中で、韓国が出遅れるリスクを減らし、国際標準に適合した制度基盤を整備するという点で大きな意義を有する。

PLT加盟が実現すれば、韓国の特許制度は主に四つの点で大きく変革される。

第一に、企業や研究者にとって負担の大きかった出願手続が画期的に簡素化される。これまで韓国語または英語でのみ提出可能であった出願書は、2029年以降はすべての言語で提出可能となり、出願日の認定要件も「出願の意思表示、出願人情報、技術内容の説明」の3点のみを満たせばよい。急速に変化する技術競争の環境下で、出願日を早期に確保する必要がある企業にとって、大きな助けとなる見込みである。

第二に、権利回復の機会が拡大される。意見提出期間や優先権主張期間など、うっかり手続を失念した場合でも、PLTの基準に沿って一定条件を満たせば、再び権利を回復できるようになる。過去3年間の権利回復申請の85%以上が個人や中小企業であったことを考慮すると、開発力はあるものの実務対応が不十分だった企業が大きな恩恵を受けることが見込まれる。

第三に、研究者や企業が最も不便さを訴えていた公証・認証手続が大幅に緩和される。現在は特許権の移転過程において印鑑証明書や、外国人の場合はサインの公証まで求められるが、今後はサインのみで権利移転が可能となるよう制度が改められる。ただし、当事者の真正性に疑いがある場合に限り、公証を求める方式で管理される。

第四に、海外出願人の韓国での代理人選任義務が緩和される。現在、海外企業は最初の特許出願時から韓国での代理人を必ず選任しなければならない。しかし、PLT加盟後は、出願および手数料納付の段階までは、自ら手続きを進めることができる。これは、海外企業の韓国における出願のハードルを下げ、韓国特許制度の国際的アクセス性を強化する措置である。

知識財産処は、PLT加盟に向けて法改正や行政・情報システムの整備、組織や予算の確保などを総合的に進めるため、「特許法条約加盟タスクフォース」を設置し、民間や産業界との緊密な協議を継続していく計画である。

知識財産処長は、「特許法条約は、知識財産処発足後に初めて加盟を推進する国際条約であり、企業の特許権確保を阻んできた規制を本格的に撤廃するものだ」と述べ、「審査期間の短縮、質の高い審査、国際競争力の強化につながる知的財産政策の革新を持続的に推進していく」と明かした。

PLT加盟は、単なる制度の一部を整備するレベルにとどまらず、先端産業の競争において韓国企業の権利を保護し、グローバルな特許環境の変化に能動的に対応できる基盤を整える重要な転換点となることが期待される。



紛争

サムスン電子、米国OLED特許訴訟で
1億9,000万ドルの賠償命令

サムスン電子が、米国で行われた特許訴訟において、1億9,140万ドル(約300億円)の賠償を命じられた。

米国テキサス連邦地方裁判所の陪審団は、サムスン電子社がピクティバ・ディスプレイズ社(Pictiva Displays)が保有する有機発光ダイオード(OLED)技術に関する2件の特許を侵害したと判断し、損害賠償を命じる評決を下した。

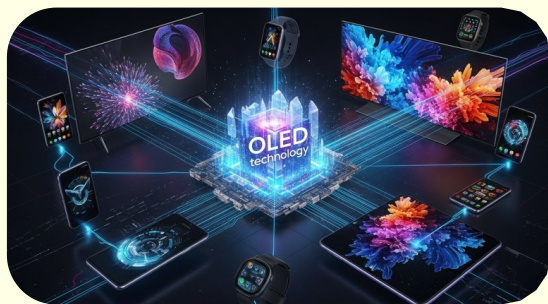
ピクティバは、2023年に提起した訴訟で、サムスン電子のギャラクシーシリーズのスマートフォンをはじめ、テレビ、パソコン、ウェアラブル機器など多くの製品に、OLEDディスプレイの性能を向上させる自社技術が使用されていると主張した。

サムスン電子はこれを否定し、当該特許そのものが無効であると反論していた。しかし、ピクティバは裁判でサムスン電子の機器が自社の特許権を侵害していると陪審団に認めさせることに成功した。

ピクティバ側は今回の評決について、「ピクティバの知的財産権の強みを証明した」と述べている。

今回の評決は、サムスン電子の機器に適用された技術に関して、特許権者が、米国における代表的な特許訴訟の中心地であるテキサス州マーシャル連邦地方裁判所に提起した複数の大規模賠償請求訴訟のうちのひとつだとされる。

アイルランドに本社を置くピクティバは、特許ライセンス企業であるキー・パテント・イノベーションズ社(Key Patent Innovations)の子会社であり、2000年代初頭に照明メーカーのオスラム社(Osram)がOLED技術を商用化する際に確保した数百件の特許を保有している。



**量子コンピューティング商用技術が急成長、
産業適用本格化の兆し**

近年10年間(2014～2023年)における量子コンピューティング技術の開発は、基礎・源泉技術中心から、ハードウェア、ソフトウェア、サービスなど、実際の産業に適用するための商

用技術中心へと急速に転換していることが明らかとなった。韓国は同期間における量子コンピューティングの特許出願の年平均増加率で世界3位(58.5%)となった。

2014年の76件から2023年の1,644件へと出願が急増、年平均40.7%の高成長

知識財産処の分析によると、2014年から2023年までの10年間に、主要国(IP5:韓国、米国、中国、日本、欧州)で出願された量子コンピューティングの特許出願は計9,162件に達した。2014年の76件から2023年には1,644件へと増加し、年平均40.7%という成長率を示している。

商用技術の特許が急増、年平均86.0%の成長

量子コンピューティング特許出願全体のうち、ハードウェア・ソフトウェア・サービスといった商用化技術は、2015年の7件から2023年には1,001件へと急増し、年平均86.0%の成長を記録した。一方、基礎・源泉技術は2014年の76件から2023年の643件へと、年平均成長率は26.8%にとどまっており、商用技術の成長スピードは、基礎・源泉技術よりも3倍以上速い水準であることが分かった。これは、量子コンピューティング技術が基礎研究段階を脱し、ハードウェア実現、ソフトウェア制御、サービス化など、産業へ適用できる可能性が拡大していることを示唆している。

米中二強体制の中、韓国は年平均増加率3位を記録

国別の出願状況を見ると、米国が4,187件(45.7%)で最多となり、中国が2,279件(24.9%)、欧州1,127件(12.3%)、日本656件(7.2%)、カナダ277件(3.0%)、韓国248件(2.7%)、イスラエル140件(1.5%)、オーストラリア95件(1.0%)と続いている。特に、米国と中国の2か国で出願全体の約70%以上を占め、国際的な技術競争を主導している。両国は基礎・源泉研究のみならず、ハードウェア・ソフトウェア分野における商用技術の出願を集中的に拡大している。韓国の出願比重はまだ低いものの、中国(123.7%)、イスラエル(109.1%)に次ぐ年平均増加率3位(58.5%)を記録しており、ハードウェア・ソフトウェア中心の商用技術出願が着実に増加していることから、産業化の初期拡散段階に入ったと評価される。

IBM・Googleがトップ維持、中国企業の急浮上と新興企業の台頭で競争構造が多角化

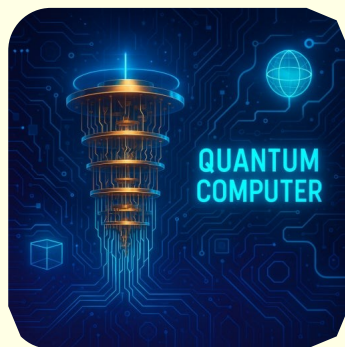
主要出願人の現況を見ると、国際的なリーディングカンパニーを中心に特許競争が激化している。2014～2023年

の期間では、IBM(1,120件)とGoogle(680件)が1位、2位を占め、量子コンピューティング分野の絶対強者としての地位を確立している。これに続き、オリジン・クオンタム(605件)、マイクロソフト(404件)、百度(373件)、IONQ(227件)、富士通(184件)、テンセント(177件)、D-Wave(175件)、IQM Finland(126件)の順となっている。

特にオリジン・クオンタム(131.8%)、百度(108.4%)、テンセント(91.7%)といった中国系企業が90%以上の特許出願成長率を記録して急浮上している。また、IONQやIQM Finlandなどの新興企業は、独自のハードウェアプラットフォームや顧客特化型アーキテクチャ設計といった差別化された技術戦略を通じて、国際市場での影響力を拡大している。

これらの動向は、量子コンピューティング技術の競争が、世界的な大手IT企業中心から、専門スタートアップや新興企業へと広がりつつあることを示す指標であり、技術エコシステムが多角化され、産業化基盤が急速に拡大していることを示唆している。

知識財産処の知識財産情報局長は、「米中を中心として量子技術を巡る国際的な覇権競争が激化する中、韓国企業が量子産業の初期拡散段階で主導権を確保するためには、研究開発と特許確保を連動させた戦略的な取り組みが不可欠だ」と述べた。その上で、「知識財産処は、量子コンピューティングをはじめとする先端新産業分野の特許動向を綿密にチェックし、韓国企業が国際市場で競争力を強化できるよう、知的財産に基づく技術革新支援を積極的に推進していく計画だ」と付け加えた。



最新技術

「バッテリーの負極をなくしたら」電気自動車の走行距離が2倍に...1回の充電でソウル・釜山を往復

POSTECH、KAIST、慶尚大学、世界最高水準のエネルギー密度を実現

ソウルから釜山まで1回の充電で往復可能か？冬でもバッテリーを気にせず電気自動車で行く可能か？韓国の研究陣が、負極をなくしたバッテリー技術でこの疑問に答えを示した。同じ大きさのバッテリーで走行距離を2倍にする技術である。

POSTECH(浦項工科大学)、KAIST(韓国科学技術院)、慶尚国立大学の共同研究チームが、最近、「無負極(anode-free)リチウム金属電池」において、体積エネルギー密度1,270Wh/Lを実現することに成功した。これは現在の電気自動車に使用されているリチウムイオン電池(約650Wh/L)の約2倍に相当する。

「無負極リチウム金属電池」は文字通り負極が存在しない。代わりに、充電時に正極にあったリチウムが移動して銅板上に直接積み重なる。不要な部品を減らした分、バッテリー内部の空間をエネルギー貯蔵により多く利用できる。燃料タンクの大きさはそのままに、より多くの燃料が入るというわけである。問題は、安全性と寿命である。リチウムが均一に積み重ならない場合、デンドライト(針状に尖った結晶)が成長して爆発の危険がある。また、充電と放電を繰り返すほどに表面が割れ、寿命も急激に短くなる。

研究チームはこれを解決するために「リチウムホスト(Reversible Host, RH)」および「設計型電解質(Designed Electrolyte, DEL)」を併せて使用する戦略を採った。「リチウムホスト」は、高分子の枠内に銀(Ag)ナノ粒子を均一に配置し、リチウムが無秩序に積み重なることなく、定められた場所に集まるよう誘導する。リチウムが整然と配置できる「リチウム専用駐車場」を作るわけである。

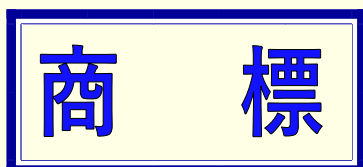
さらに「設計型電解質」を加えた。電解質はバッテリー内でリチウムが移動する通路の役割をする液体であり、研究チームが設計した電解質は、リチウムと反応して Li_2O 、 Li_3N からなる薄くて硬い保護膜を形成する。この保護膜は、肌に絆創膏を貼るようにリチウムの表面を覆い、デンドライトの成長を防ぎながらリチウムの移動通路が開かれた状態にしておく。

この2つを組み合わせたRH-DELシステムは、高容量($4.6\text{mAh}/\text{cm}^2$)および高電流密度($2.3\text{mA}/\text{cm}^2$)の条件下で100回の充電・放電後でも初期容量の81.9%を維持しており、平均99.6%という高いエネルギー効率を記録した。このような安定した性能を基に、研究チームは無負極リチウム金属電池で体積エネルギー密度 $1,270\text{Wh}/\text{L}$ の実現に成功した。

特に、今回の成果は、実験室用の小型電池だけでなく、パウチ型電池でも検証された。電解液を最小限に使用し($E/C=2.5\text{g}/\text{Ah}$)、バッテリーを強く圧迫しない低い圧力条件(20kPa)下でも安定して作動した。これは、実際の自動車に搭載する際に、重量や体積を減らしつつ製造時の負担を軽減できることを意味しており、商用化への可能性を一層高めたものと評価されている。

研究チームは、「負極のないリチウム金属電池における安全性と寿命の問題を同時に解決するという意義のある成果である」と、研究の意義を語った。

今回の研究成果は、国際学術誌「Advanced Materials」に掲載された。



「メロナ＝ビングレ」

カザフスタンで「ニセモノ撲滅」の商標権訴訟

韓国の食品メーカー、ビングレ社(Binggrae)がカザフスタン市場でアイスクリーム「メロナ」の模倣製品メーカーに対し、訴訟に踏み切った。グローバル市場におけるK-アイスクリームの地位を守ることはもちろん、ブランドの保護を目的としている。

業界関係者によると、ビングレは現在、カザフスタンのA社を相手取り、メロナの模倣製品に対する商標権侵害および不正競争防止法違反の訴訟を進めている。

A社は過去にビングレと業務提携していた企業で、カザフスタン市場においてメロナなどアイスクリーム製品の生産を担当していた。A社は中央アジアのアイスクリーム市場で40%のシェアを占める主要企業でもある。

ビングレは2007年にA社と契約し、カザフスタン現地でメロナの販売を開始した。メロナの商標権は2010年にカザフスタンで正式に登録されている。

A社が販売している模倣製品は、アイスクリームの形状や、棒に施されたレタリングまで、すべてメロナと同一である。包装を除けば、事実上同一の商品といえる。

現在、この模倣製品は現地のオンラインモールなどで約345テンゲ(約100円)で販売されている。これはメロナ正規品の価格である900テンゲの半額にも満たない。

カザフスタンにおけるメロナ模倣製品を巡る訴訟は今回が初めてではない。2019年にも類似の事例で勝訴しているが、訴訟が完全に終結した2021年まで当該模倣製品は現地で販売され続けていた。

ビングレがA社に勝訴したとしても、数年に及ぶとみられる訴訟期間中、A社の模倣製品販売を阻止することはできない状況だ。

ビングレの関係者は、「現在、カザフスタンで販売されているメロナの模倣製品について、商標権侵害および不正競争防止法違反の訴訟を進めている」と述べた。



ブランドバッグのリフォームは商標権侵害か 大法院、ルイ・ヴィトン事件で公開弁論

ブランドバッグをリフォームして違った形の製品にする行為が、商標権侵害に当たるか否かを巡り、大法院が公開弁論を開いた。個人所有のブランド品を改造・再加工するいわゆる「リフォーム」産業の法的限界を測る大法院の判断は初となる。

大法院によると、大法院第2部は、12月26日に商標権侵害差止請求事件に関する公開弁論を行った。対象事件は、高級ブランド「ルイ・ヴィトン」とリフォーム業者との商標権紛争で、リフォーム行為自体が商標法上の侵害に該当するかが主要な争点となった。

事件の発端は、リフォーム業者がバッグ所有者の依頼を受け、ルイ・ヴィトンのバッグを別の形のバッグや財布などに再加工し、その対価を受け取ったことにある。リフォームされた製品には、既存のルイ・ヴィトンのロゴがそのまま残されていた。

これに対しルイ・ヴィトンは、リフォーム業者の行為は、商標が付された商品が無断で製造・流通させることと変わらないとして、商標権侵害差止および損害賠償を請求した。リフォーム後もロゴが残っているため、消費者がブランドの出处を誤認するおそれがあると主張している。

一方、リフォーム業者側は、バッグ所有者は正当に取得した物品を自由に改造する権利があり、専門の技術者に

よってこれを行うことも許容されるべきだとして、商標権侵害には当たらないと反論している。

今回の事件では、△リフォーム業者の行為が出处表示機能を果たす商標の使用に該当するか、△リフォーム後の製品は商標法上の新たな「商品」と見なし得るか、△消費者に商品の出处に関する混同を生じさせる可能性があるか、などが主要な争点として扱われた。

これまで一審・二審の裁判部は、リフォーム行為が商標権侵害に当たると判断し、ルイ・ヴィトンの主張を認めた。しかしリフォーム業者はこれを不服として上告し、事件は大法院の判断を仰ぐこととなった。

今回の公開弁論には、双方の主張を裏付ける専門家が参考人として出席し、意見を述べた。大法院は、「韓国国民の関心が高く、社会的影響が大きい事案について公開弁論を拡大し、政策法院としての機能を強化するとともに、司法に対する信頼を高めたい」と明かした。



韓国における知的財産問題でお悩みですか 新しい選択、HA & HAにお任せ下さい

(調査・特許・実用新案・デザイン・商標の出願及び登録、著作権、電子商取引、
インターネット上の権利、コンピュータープログラム、侵害訴訟及び各種紛争)

河 合同特許法律事務所

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-548-1609
Fax : +82-2-548-9555, 511-3405
E-mail : haandha@haandha.com
Website : <http://haandha.com>

SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-3443-8434
Fax : +82-2-3443-8436
E-mail: st@stpat.co.kr